

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 1 区分
 【発行日】平成 16 年 9 月 2 日 (2004.9.2)

【公開番号】特開 2002-286574 (P2002-286574A)
 【公開日】平成 14 年 10 月 3 日 (2002.10.3)
 【出願番号】特願 2001-89051 (P2001-89051)
 【国際特許分類第 7 版】

G 0 1 L 19/06

【 F I 】

G 0 1 L 19/06 A

【手続補正書】
 【提出日】平成 15 年 8 月 19 日 (2003.8.19)

【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 0 3
 【補正方法】変更
 【補正の内容】

【 0 0 0 3 】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、前記圧力センサにおいては、ある程度の耐食性を有するものの、金属を使用しているため、塩素系の腐食ガス例えば HCl と水分 (H₂O) が共存する厳しい腐食環境下では金属が腐食する恐れがあった。腐食が進むと、誤検知ないし圧力シフトやウエハへの金属汚染 (メタルコンタミネーション) が発生する恐れがあり、半導体製造装置では安定したプロセスを行なうことが困難になることが予想される。このため、高耐食性を有する圧力センサが要望されている。なお、ゲージ圧 (大気圧 ~ 加圧) 測定用の圧力センサでは比較的高い耐食性を有するものが開発されているが、真空圧力計測用の絶対圧センサでは未だ高耐食性を有するものが実現されていない。

【手続補正 2】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 0 4
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【 0 0 0 4 】

本発明は、前記事情を考慮してなされたもので、高耐食性を有する真空計測用の絶対圧センサを実現でき、厳しい腐食環境下でも腐食による圧力シフトや被処理体への金属汚染を発生させることなく圧力を計測でき、半導体製造装置では安定したプロセスを可能とする圧力センサを提供することを目的とする。

【手続補正 3】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 2 1
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【 0 0 2 1 】

前記圧力センサ 1 は、例えば半導体製造装置に使用される。図 4 は圧力センサを使用した半導体製造装置の一例を示す図である。20 は半導体製造装置の一例である縦型の熱処理装置で、被処理体である半導体ウエハ W を収容し、処理ガスとして水蒸気を導入して例えば 850 程度の高温下で熱処理する熱処理炉 21 を備えている。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0025

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0025】

また、前記反応管22の下側壁には、反応管22内を排気するための排気管部30が設けられており、この排気管部30には、排気系31を構成する排気管32が接続されている。この排気管32は、耐食性配管からなり、例えば金属製好ましくはステンレス製の配管の内周面に耐食性樹脂好ましくはフッ素樹脂のコーティングを施してなる。前記排気管32の下流端は、処理炉21内を例えば最大1Pa程度に減圧可能な減圧ポンプ（真空ポンプ）に接続され、この減圧ポンプの下流には除害装置が接続されている（図示省略）。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0026

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0026】

そして、前記排気管32には、開閉および圧力調節の可能なコンビネーションバルブ33が設けられている。このコンビネーションバルブ33は、耐食性を有する材料例えばフッ素樹脂により形成されているか、あるいは排気ガスと接する接ガス面がフッ素樹脂の被膜で被覆されていることが好ましい。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0027

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0027】

前記排気管32における減圧処理用コンビネーションバルブ33よりも上流位置には、排気圧力を検出する前記圧力センサ1が設けられている。この圧力センサ1は、例えば0～133kPa（0～1000Torr）もしくは0～1.33kPa（0～10Torr）のレンジで検出が可能とされている。コンビネーションバルブ33は、前記圧力センサ1の検出圧力を基に制御手段であるコントローラ34により制御されるようになっている。

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0031

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0031】

（1）請求項1の圧力センサによれば、内部が中空で一端に圧力導入部を有する本体と、該本体の内部に前記圧力導入部側とそれ以外の部分とに仕切るべく気密に設けられたセンサモジュールとを備え、該センサモジュールは真空室と、該真空室と前記圧力導入部とを仕切る受圧部と、該受圧部の内面に設けられた検出素子とを有し、前記本体およびセンサモジュールの少なくとも接ガス面を非金属の高耐食性材料により形成しているため、高耐食性を有する真空計測用の絶対圧センサを実現でき、厳しい腐食環境下でも腐食による圧力シフトや被処理体への金属汚染を発生させることなく圧力を検出でき、半導体製造装置では安定したプロセスが可能となる。